This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

BRIGHT ANNEALING PROCESS

Patent Number:

JP54148112

Publication date:

1979-11-20

Inventor(s):

NAKAGAWA SHIGESABUROU

Applicant(s):

NAKAGAWA KK

Requested Patent:

JP54148112

Application Number: JP19780057314 19780515

Priority Number(s):

JP19780057314 19780515

IPC Classification:

C21D1/26; C21D1/74; C22F1/08

EC Classification:

Equivalents:

JP1244180C, JP59019187B

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-148112

(f) Int. Cl.² C 21 D 1/26 C 21 D 1/74

C 22 F 1/08

識別記号 **②日本分類** 10 A 741 10 L 16 10 A 710.1 庁内整理番号 7217—4K ❸公開 昭和54年(1979)11月20日

有

7217-4K 7217-4K 発明の数 7109-4K 審査請求

(全 5 頁)

60光輝焼鈍法

②特 5

願 昭53-57314

@出

顧 昭53(1978)5月15日

仍発 明 者 中川繁三郎

市川市八幡 4-14-20

⑪出 願 人 中川株式会社

東京都台東区柳橋1丁目29番7

号

個代 理 人 弁理士 箕浦清

明 細 1

1

- 1. 発明の名称 光輝焼鈍法
- 2. 特許請求の範囲
- 2. 混合ガス中における水業ガスの分圧を4% 程度とした特許請求の範囲第1項記載の光輝

烧蝇法。

- 3. 混合ガスによる炉内の洗浄を炉内圧力が 1/100 気圧程度の減圧下で実施する特許請 求の範囲第1項又は第2項記載の光輝鏡銭法。
- 4. 昇温工程、焼飯工程及び冷却工程において 炉の内外圧力差を 0.0 1 kg/cd 程度とする特許 請求の範囲第 1 項から第 3 項までのいずれか 1 項記載の光輝鏡館法。
- 、 発明の詳細な説明

本発明は真ちゆうその他の個合金を実質的 に酸素を含有しない水素よん囲気中で光輝焼 鈍する方法に関するものである。

特開 昭54-148112(2)

又炉内ガスの端点をかなり下げておかない。 とガス中の水分が焼鈍時に熱分解して全国材料の表面を酸化するいで十分な光輝焼鈍の効果は達成されない。

そこで光輝焼鈍炉に比較的安価でしかも大量に還元性ふん囲気を供給する方法として炉内でアンモニアクラツキングを行いちつ案と酸素との混合ガスふん囲気を曳出する方法も提案されているが、この方法の場合そのふん囲気ガス中から水分を除去してその惑点を十分に下げるには複雑で高価な設備を必要とする。

本発明はこのような問題点を解析する。 たなされたもので、以下これを辞述する。 光輝焼艶すべき金属材料を収取の真空にした密焼の内部を一たん2mm H が 程度の真空にレオントラのちで素がスと連ばして水素がストラの水素がスを適宜に混合したが、水からの水素がスを適宜に混合したものの混合がスにより、これら混合が、これら混合が、これら、これの混合が、これら、これの混合が、これら、これの混合が、これら、これの混合が、これら、これに関大の洗剤を 減圧下に反復して行い、然る後焼鈍温度までの加熱昇温中は膨脹する炉内のガス圧を逃すことも兼ねて焼鈍炉内に外圧よりも右干高い内圧となるように上配のちつ素と水素との混合ガスを注入しその際一方の口からは内部のちつ素と水素ガスを逃げるのを許すと共に底視合ガスを他方の口より補給して絶えず炉内の圧力を外圧よりも若干高めに維持せしめる。

そこで焼鈍温度、例えば真ちゆうの場合的500~550℃に建したら暫時例えば30~60分そのまゝの温度に保持し、次に冷却の段階では炉内の収縮するガス体積に見合う以上の混合ガスを供給して絶えず炉内圧力が外圧より若干高くなるようにしておく。

このようにしてちつ素と水素の混合よん朗 気中で冷却してから金属材料を炉内より取出 すことによつて所期の光輝焼飯が達成される。

本発明の実施において炉内をちつ柔と水素 との混合ガスで洗浄するときの炉内の減圧度 は 1 / 100 気圧以下とするのが望ましく、又

この洗浄工程、焼蝕工程次の冷却工程における水紫ガスの分圧は4%程度で十分であり、 前出の昇温工程、焼鈍工程、冷却工程における炉内外の圧力差は0.01 に程度であればよい。

以上本発明法による利点を要約して別記すると次の通りである。

- (1) ちつ素額として液体ちつ素を用いている ので酸素含有量は非常に少く又水分もない ため焼鈍すべき金属材料の酸化度が余り進 んでいない場合には高価な水素の使用量が 非常に少くて済み経済的に極めて有利であ る。
- (2) しかも焼飾工程及びその前後の工程を水 素ガスの分圧 4 %程度の水楽とちつ素との 混合ガス中で実施するので爆発限界外で操 業できるので作業管理面で極めて有利であ り、又低コストで実施できることにもなる。
- (3) 焼鈍炉内を一たん2mH が位にまで真空 にしてから上記の混合ガスで1/100 気圧

程度の減圧下で反復して炉内を洗浄するので金属材料に付着ないし発生していた或いは炉内に残存していた数量の酸素ガス及び水分を系外に除去できるので、次の焼塩工程では水業ガスの分圧が低い混合ガスふん 囲気中でも十分な光輝焼鈍の効果が達成される。

- (4) 昇湿工程、焼飽工程及び冷却工程では炉内の成合ガスの圧力を絶えず外圧よりも 1/100 気圧程度高くしているので炉内に 外気の入り込むおそれもなく安全であり、 又所望の光輝焼鈍の効果が保証される。
- (5) 少量の混合ガスで炉内及び炉内の金属材料を予め洗浄する予備工程を設けたことにより光輝焼館の工程(その前後の昇温及び冷却も含む)に使用される混合ガスの使用量が極めて少くて済み、しかも高価な水業ガスは該混合ガス中4%前後と少量であるので、一層有利であり、かつ安全である等での工業的価値大である。

以下に本発明の実施例を示す。 P-1の第1四において切は値線機で伸線した丹鯛 (Cu85%) の線材を示しこれを約500線の線束 (コイルでもよい)、としてある。

このような線材のを架台のの上に致けられた下部電気炉の上に架設されたボール値に引かけて低むがボール値は東が崩れないように 後むためのものであり、その他製品によって は適宜に設けられた棚等が用いられる。 次にマプフル(保護容器)③をクレーンで吊 上げて、電気炉①にかぶせてから、締金⑥を 締めて、マツワルと炉台間を密封する。マツ ブルの内径は約 1,1 0 0 mm 、高さ 1,4 0 0 mm 内容積約 1,3 0 0 & である。浄却管⑦に水を 旅し、次いでペル型選気炉①のスイツチを入 れ、加熱を開始すると同時に第2図に示す異 空ポンプ(3)のスイッチを入れる。尚その前に パルブVー③をしめVー(Jを関けるが、パル プVー③、Vー④、Vー⑤は閉まつている。 約10分后にはマツフル③内の温度は50℃ 以上に達する、又真空度は2-3mHfとなる。 そこでパルブVー④、Vー⑤を開け、微量注 入パイパス回路(19の圧力を調整して、極めて 少量ずつ一大体 1.3 4/分水一混合ガスを流 して、マツワル内の践量空気を完全に置換す る(約10分間)。この際真空度を8㎜49 即ち、 1400 気圧以上にならぬように注意す る。混合ガスは液体もつ紫タンク印からの



N。と水素ポンペ 60か6のH。を容量比96:4位にしたもので、自動混合装置ので混合を行い、レシースタンク傾に貯められる。この操作で、一気圧下だと10回マツフル内の空気を交換するに要する13㎡のガスの1/100の0.13㎡でもつて同様の比率で0。の含有率を下げることが出来又気圧が1/100以下なので更に1/100以下に0。含有率を下げることが出来る。即ち前のガスで100倍の効果を上げることが出来、もし、N。+H。ガス中の0。含有量も1PPm 以下にすることが出来る。

次に パルプ V - ①をしめ 真空ポンプのスイッチを切り、 パルプ V - ④をしめ パルプ V - ⑤を開け、 急速に マツフル内に ガスを充たす。 真空 Y - レ ② は 7 6 0 mmH f に 戻り、 マツフル内の 温度の上昇につれて 7 ~ 1 0 mmH f / 分の速度で内圧が上昇してくる。

バルブVー③を締め、其空ケージ 図によつて

上昇する内圧(正圧)が約8 mmH s (0.01 kg / cd) 以内に止まるように、パルブ V - ③を開き、影張するガスを逃がす。(0 ~ 18 8 / 分)、約2時間でマップル内の温度は丹銅線の十分な焼飽温度である 5 5 0 でに達する。パルブ V - ④を再び開き、微量パイパス 40を用いて微量のガスを補給しながら、約1時間そのままに保つ。

約1時間の保持時間后に電気炉のスイッチを切り、クレーンで吊り上げて除く、マッフルを急速に冷却するには冷却フードをかぶせて 冷水噴霧を行うか、冷風を吹付ける。この際 常に微量ガス注入パイパス(Mの圧力を調整し て、マッフル内が減圧状態にならないように 注意する。

マツフル内の温度が50℃位まで下がつてから微量パイパス (例を閉じ、パルブリー③を 助いて空気を注入し、マツフルを除き、品物 を取出す。

丹銅線は完全に鈍され、(拡張力約28~

特勝昭54—148112(4)

3 0 4 / ■)且つその光沢、色沢は全く扱われない。

以上の如く、本発明の方法によると、

- ①使用するガス量が極めて少ないにも拘らず (上記500%の焼鈍において、96%N*+ 4%N*ガスの使用盤は一回最大4㎡にすぎない)
- ②液体もつ案からのN。ガスを主成分とし、H。 ガスを約4%含む、極めて安全なガス(H。 の爆発限界4.1%)であると同時に、マッフル内の空気即ちO。を監検除去すること が出来る。
- ③同時に揮発性の袖を除いて、色沢に悪影響 を与えない。
- ④極めて光状のある、又色沢においても優れ

たCu合金の焼鈍が行われる。

- ⑤設備費、ガス代共コストが安く酸洗及びそれに伴う手間と、公害防止費用を勘案すると非常に経済的である。
- 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法の実施に用いられた光 輝焼鈍炉の断面見取図、第2図は本発明方法 の実施例における回路図である。

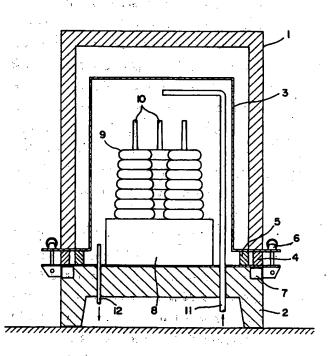
- 1 ……… ペル型電気炉
- 2 ----- 架台
- 3 ----マツフル
- 4 ---- ゴムハツキング
- 5 ----- 耐熱シール
- 6 ----- 益 金
- 7 ----- 冷却管
- 8 ----- 下部電気炉
- 9 ------ 線 材
- 10 ---- ポール
- 11 --- #ス入口

1年

- 12 ---- 排気口
- 14 ---- 世景注入パイパス
- 15 ………液体ちつ素タンク
- 16 ----水梁ポンペ
- 17 ………自動ガス定量混合装置
- 18 ----レシーパタンク
- 19 ----流量計 (容量0~304/分)
- 19 -- -- 流量計
- 20 … … 一次圧力網整器
- 21 … … 二次
- 22 … … … 圧力調整器およびパルブ
- 23 --- --- 逆止井
- 24 --- パツキュームゲージ
- 25 … … … マノメータ
- 26 ………レリーズパルブ

V-1~V-5----パルブ

第 | 図



代理人 宴 浦

第 2 図

